WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA LINII KRIOGENICZNEJ XATL1

SELECTED ASPECTS OF THE XATL1 CRYOGENIC LINE DESIGN

Eugeniusz Rusiński, Artur Iluk, Kazimierz Malcher – Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska

Maciej Chorowski, Jarosław Fydrych – Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono wybrane problemy projektowania kriogenicznej linii helowej XATL1. Omówiono założenia do budowy modelu geometrycznego 3D instalacji kriogenicznej, przedstawiono przykładowe rozwiązania modelowe 3D i obiekty rzeczywiste. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń wytrzymałościowych. Analizę wytrzymałości rurociągu pracującego w ultra niskich temperaturach i współpracujących z nim urządzeń, przeprowadzono z wykorzystaniem MES oraz opracowanych modeli geometrycznych 3D projektowanych obiektów. Przy ustalaniu warunków brzegowych uwzględniono przypadki odpowiadające normalnej pracy projektowanej instalacji jak również przypadki odpowiadające stanom wyjątkowym jak próby ciśnieniowe lub awaria systemu. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych dokonano weryfikacji założeń i opracowanych modeli geometrycznych 3D, które po wprowadzeniu niezbędnych poprawek, wykorzystano do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej kriogenicznej linii XATL1.

The paper presents selected aspects of designing cryogenic helium lines XATL1. In the paper the design of a 3D geometric model of the cryogenic installation, the examples of the design solutions and real objects were presented. It also presents examples of the results of the strength calculations. The strength analysis of the transfer line was carried out using Finite Element Method. The analyzed load cases take into account the boundary conditions corresponding to the normal operation of the proposed installation as well as special cases of the pressure tests and system failure. Based on the results of numerical calculations, design assumption were verified and geometric models were modified to fulfil requirements of the AD 2000-Merkblatt code.

Wprowadzenie

Powstający w narodowym laboratorium DESY w Hamburgu laser na swobodnych elektronach X-FEL (X-rays Free Electron Laser), przeznaczony do badań materiałowych i biologii molekularnej, należy do największych i najbardziej nowatorskich urządzeń badawczych tego typu na świecie. Trwające od 2007 r. prace związane z budową tak dużego urządzenia badawczego, między innymi ze względu na koszty, realizowane są w ramach międzynarodowego projektu X-FEL, którego budżet stanowią wkłady rzeczowe i finansowe wielu krajów, w tym Polski – pełnoprawnego udziałowca międzynarodowej spółki i współwłaściciela powstającej infrastruktury badawczej.

W budowanym laserze na swobodnych elektronach, podobnie jak w akceleratorach o dużych energiach, powstających od lat 90-tych XX wieku, pozwalających na dokonywanie nowych odkryć fizycznych, zastosowano kriogenikę helową, która umożliwia utrzymywanie nadprzewodników w odpowiednio niskiej temperaturze. Systemy przesyłania i dystrybucji helu w dużych instalacjach kriostatowania nadprzewodników, stanowią do dziś duże wyzwanie dla projektantów wykorzystujących najbardziej zaawansowane technologie mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, materiałowe, informatyczne.

Aktualnie brak jest pełnej wiedzy pozwalającej na optymalizację projektowanych dużych linii kriogeniki helowej pod kątem uzyskanie najwyższej ich niezawodności, a realizacji takich projektów mogą podjąć się nieliczne ośrodki naukowe w świecie.

W ramach udziału Polski w międzynarodowym projekcie X-FEL, jako wkład rzeczowy, została zaprojektowana, wykonana i wdrożona do eksploatacji, po raz pierwszy przez stronę polską, unikalna linia kriogeniczna XATL1, wraz z kriostatami helowymi i dodatkowymi liniami przesyłowymi. Urządzenia te wykorzystywane są do kriostatowania testowanych wnęk rezonansowych nad ciekłym helem dwufazowym, transportowanym z hali AMTF oddalonej około 160 m od bloku HERA West (rys. 1) [3] w ośrodku DESY w Hamburgu.

Projekt instalacji, badania modelowe oraz techniczną dokumentację wykonawczą, zatwierdzoną przez TÜV NORD, wykonano w Politechnice Wrocławskiej. Opracowany projekt kriogenicznej linii helowej posiada wiele rozwiązań innowacyjnych.

Produkcji kompletnej instalacji kriogenicznej oraz jej montażu w Hamburgu, zakończonego pełnym sukcesem (rys. 2), tj. uruchomieniem i bezawaryjną do dziś pracą, podjęła się wrocławska firma Kriosystem Sp. z o.o. Najwyższą jakość wytwarzanych elementów i podzespołów, weryfikowano zarówno w procesie ich produkcji jak i na montażu, za pomocą wielu prób i testów jak np.: szczelność helowa rur procesowych i ich połączeń, jakość i wytrzymałość elementów oraz połączeń poddanych przeciążeniom wynikającym z obciążeń próbnych, "szokowanie" elementów instalacji, możliwość kompensacji odkształceń termicznych, możliwość uzyskania założonego stopnia próżni, szczelność cieplna, itp.

W procesie projektowania innowacyjnej kriogenicznej linii XATL1, wykorzystano najnowsze techniki CAD/CAE.

Budowa modelu geometrycznego 3D linii kriogenicznej

Jednym z podstawowych ograniczeń, które należało uwzględnić przy ustalaniu założeń i warunków brzegowych do projektu kriogenicznej linii XATL1, była istniejąca już stalowa



Rys. 1. Kriogeniczna linia helowa XATL1: widok ogólny oraz fragmenty instalacji ułożonej na estakadzie łączącej oddalone obiekty – modele 3D i obiekty rzeczywiste

konstrukcja estakady (rys. 1 i 3), na której należało ułożyć rurociąg. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz założeń dotyczących funkcjonowania projektowanego obiektu [1-4], przyjęto oryginalny sposób podarcia rurociągu na estakadzie za pomocą 2 podpór stałych VLA oraz 28 podpór przesuwnych VL (rys. 3 i 4). Przyjęto sposób kompensacji odkształceń rurociągu na estakadzie oraz sposób przyłączenia go do innych obiektów (VB i SB rys. 3). Po uwzględnieniu możliwości wykonawczych oraz ograniczeń wynikających z transportu i montażu projektowanych urządzeń (rys. 5) jak również dążenia do minimalizacji



Rys. 2. Uroczyste przecięcie wstęgi i przekazanie polskiego wkładu - linii kriogenicznej oraz kriostatów do X-FEL'a - Hamburg 10 luty 2013 r.



Rys. 3. Widok linii XATL1: a) podział na segmenty, b) schemat podparcia na moście, c) moduł końcowy rurociągu (model i obiekt rzeczywisty); rodzaje podpór i kompensatorów: V – vertical, L – Lateral, A – axial, CA – axial compensator, CL – lateral compensator



Rys. 4. Podpory rurociągu na moście - model 3D i obiekty rzeczywiste na montażu



Rys. 5. Transport i montaż segmentów rurociągu

kosztów realizacji projektu, dokonano podziału całego rurociągu na 11 segmentów liniowych oraz 4 segmenty z łukami – "kolana" (rys. 3). Na podstawie przyjętych założeń, opracowano modele geometryczne 3D poszczególnych elementów i podzespołów instalacji kriogenicznej i poddano szczegółowym analizom numerycznym MES. Wirtualny montaż oraz symulacje wzajemnych przemieszczeń współpracujących elementów, umożliwiły wyeliminowani wielu nieprzewidzianych kolizji, charakteryzujących rozwiązania prototypowe. Zweryfikowane obliczeniowo i poprawione modele geometryczne 3D projektowanych urządzeń, wykorzystano do opracowania ich kompletnej dokumentacji technicznej, którą zatwierdziła i dopuściła do produkcji, niezależna, certyfikowana jednostka TÜV NORD.

Zewnętrzna rura linii kriogenicznej XATL1, spełniająca rolę ustroju nośnego rurociągu, stanowi jednocześnie kon-

strukcję wsporczą i osłonę próżniową dla znajdujących się w niej obiektów m.in. takich jak rury procesowe i ich ekran termiczny (rys. 6).

Obciążenia termiczne, szczelność cieplna i różne ciśnienia, to podstawowe parametry decydujące o bardzo złożonej strukturze projektowanej linii (rys. 6, 7). Skrajnie niskie oraz różne temperatury rur procesowych (tab. 1), ekranu termicznego (40 - 80 K) i rury próżniowej (ok. 313 K), to przyczyna występowania znacznych odkształceń termicznych.

Ciągłą kompensację odkształceń oraz zachowanie stałych odległości promieniowych pomiędzy rurami, uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego systemu stałych i przesuwnych podpór rur procesowych i ekranu termicznego (rys. 7, 8) współpracujących z kompensatorami i elastycznymi wężami montowanymi na składaniu segmentów rurociągu (rys. 9).



Rys. 6. Przekrój poprzeczny i widok rurociągu: rury procesowe z kompensatorami – modele 3D i obiekty rzeczywiste, 1 – GHe powrót, 2 – SHe zasilanie, 3 – ekran termiczny powrót, 4 – ekran termiczny zasilanie, 5 – ekran termiczny, 6 – ekran próżniowy



Rys. 7. Podpory rur procesowych - modele i obiekt rzeczywiste: a) pojedyncza i podwójna podpora przesuwna, b i c) podpory stałe

Skuteczną, cieplną izolację rur procesowych od rury próżniowej uzyskano dzięki zastosowaniu umieszczonego w próżni ekranu termicznego (rys. 10) oraz specjalnych izolacji nawijanych na rury (rys. 11). Do chłodzenia ekranu wykonanego ze stopy aluminium wykorzystano stalową rurę procesową (80 K – rys. 10), połączoną termicznie z ekranem za pomocą zestawu miedzianych mostków. Dobór liczby mostków oraz sposobu ich mocowania, poprzedziły liczne badania modelowe i eksTab. 1. Zestawienie wymaganych parametrów pracy linii kriogenicznej XATL1 oraz widok tabliczki znamionowej rurociągu

process tube	diameter	design pressure	operating pressure	test pressure	operating temperature
4,5 K suppply	DN 50	20 [bar]	3,5 [bar]	28 [bar]	4,5 [K] - 6 [K]
4,5 K return	DN 80	20 [bar]	1,2 [bar]	28 [bar]	4,5 [K]
40 K supply	DN 40	20 [bar]	17 [bar]	28 [bar]	40 [K]
80 K return	DN 40	20 [bar]	16.7 [bar]	28 [bar]	80 [K]

and the	KRIOSYSTEM Sp. z o.o. 54-424 Wrocław ul. Muchobo Location of Wrocław Technolo					
Santa Santa	AD 2000					
Names of Street, Stree	Cryogeni	c Transfer	Line XATL	1.		
Ranne Mincourty Berlie namber	01/12		-	-		
Propinsion Constraints	Sile supply	GHe niture	Excely	Internal Sheet		
anti- base, displayed allowing the second	-1/20	-1/20	-1/20	-1/20	ba	
Adv. real. Ministerior in reservoirs.	-269/37	-269/37	-269/37	-269/37]*C	
Mandant columns Mandant Columns	Helium	Hellum	Helium	Heilum	3	
Brances Contrastes	50	80	40	40	1	
Council and could	167	167	167	167	m	
CE						



Rys. 8. Podpory ekranu termicznego - modele i obiekty rzeczywiste na montażu



Rys. 9. Kompensatory i elastyczne węże – modele 3D i obiekty rzeczywiste





Rys. 10. Termalizacja ekranu ze stopu aluminium: miedziane mostki łączące ekran ze stalową rurą procesową (80 K) – model 3D i obiekty rzeczywiste na montażu



Rys. 11. Izolacje termiczne rur procesowych i ekranu

perymentalne. Zastosowana konfiguracja materiałów wynikała z konieczności zapewnienia dobrej przewodności cieplnej oraz uniknięcia wystąpienia ogniwa galwanicznego w temperaturach kriogenicznych.

Obliczenia wytrzymałościowe linii kriogenicznej

Celem analiz wytrzymałościowych prowadzonych z wykorzystaniem MES [5, 6, 7] było określenie rzeczywistych odkształceń i stanu wytężenia linii kriogenicznej (rys. 12 - 15), odpowiadających obciążeniom termicznym i zmianom ciśnienia w stanach pracy ustalonej oraz podczas rozruchów linii. Badano również skutki przeciążeń towarzyszących obciążeniom wyjątkowym pojawiającym się podczas prób ciśnieniowych czy też w przypadku możliwych awarii systemu chłodzenia (rozszczelnienia rury procesowej i przedostania się helu do rury próżniowej lub rozszczelnienia osłony próżniowej). Na podstawie uzyskanych wyników ustalono parametry systemu zewnętrznego podparcia rurociagu na estakadzie (rys. 3) i wewnętrznego podparcia rur procesowych oraz ekranu termicznego (rys. 6, 7). Wyznaczenie ekstremalnych odkształceń elementów i całego rurociągu, umożliwiło dobór rodzajów, ilości i zakresów pracy zewnętrznych oraz wewnętrznych kompensatorów jak również elastycznych węży (rys. 9). Na podstawie wyznaczonych odkształceń ustalono również wymagane wielkości napięcia wstępnego zastosowanych kompensatorów osiowych.

Podstawowym kryterium doboru materiałów, z których wykonano rurociąg jest temperatura przesyłanego czynnika. Zgodnie z normą AD 2000-Merkblatt W10 (tab. 2), na elementy modułów linii kriogenicznej zastosowano materiały, które w temperaturach kriogenicznych, spełniają warunki wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej ustalone dla danego przypadku obciążenia.

Przyjęte do obliczeń parametry pracy poszczególnych rur procesowych linii kriogenicznej zestawiono w tabeli 3.

Wybrane cechy materiałów użytych do produkcji elementów linii kriogenicznej:

- rury procesowe stal austenityczna DIN 1.4306: $R_{0,2} = 210 \text{ MPa}, R_m = 564 \text{ MPa},$
- ekran termiczny stop aluminium 6060: $R_{0,2} = 60$ MPa, $R_m = 120$ MPa,
- ekran próżniowy stal austenityczna DIN 1.4301: $R_{0,2} = 215$ MPa, Rm = 505 MPa,
- podpory przesuwne rur procesowych G10: $R_m = 280$ MPa

Wymagany, zgodnie z AD2000-Merkblat W10, współczynnik bezpieczeństwa – 1,5.

W obliczeniach wytrzymałościowych MES uwzględniono trzy podstawowe przypadki obciążenia linii kriogenicznej:

- 1. Obciążenia próbne:
 - temperatura elementów 285 °K (260 310 °K dla Hamburga)

Tab.	2. AD	2000-Merkblatt	W10 – tabela	1: materialy rur	procesowych	rurociagu	XATL1
ruo.	2.110	2000 Micholatt	WIO MOCIA	i, materiary rui	procesowyen	Turbeiųgu .	

No Type of steel		Grade of steel, grade of cast steel		Lowest possible operating temperature °C for stress case			Maximum permissible thickness, wall thick- ness for tubes	Maximum permissible diameter
				1	11	111	m	im
1	2	3		. 4	5	6	7	13)
3	Welded tubes made from stainless austenitic and austenitic-ferritic steels as specified in DIN EN 10216-5 Seamless tubes made from	X5CrNi18-10 X6CrNiNb18-10 X5CrNiNb017-12-2 X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3 ³) X2CrNiMo18-14-3 ³) X2CrNiMoNb17-13-5 ⁷) X6CrNiMoNb17-12-2 ⁴)	1.4301 1.4550 1.4401 1.4404 1.4435 1.4439 1.4580	- 200	- 255	- 273	50	
	stainless austenitic and austenitic-ferritic steels as specified in DIN EN 10217-7	X2CrNi19-11 X6CrNiTi18-10 X6CrNiMoTi17-12-2 X2CrNiN18-10	1.4306 1.4541 1.4571 1.4311	- 273 ²⁾	- 273	- 273		-
		X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	-273	-273	-273		
		X2CrNiMoN22-5-37)	1.4462		- 60	- 60		

Tab. 3. Wartości ciśnienia i temperatur do obliczeń numerycznych linii kriogenicznej

Line	Nominal condition		Pressure test condition		
	Pressure	Temperature	Pressure	Temperature	
Thermal shield return DN 40	2,0 MPa	80 K	2,86 MPa	20°C (313 K)	
Thermal shield supply DN 40	2,0 MPa	40 K	2,86 MPa	20°C (313 K)	
SHe supply DN 50	2,0 MPa	4,5 K	2,86 MPa	20°C (313 K)	
GHe return DN 80	2,0 MPa	4,5 K	2,86 MPa	20°C (313 K)	



Rys. 12. Model dyskretny linii kriogenicznej z podziałem na elementy skończone

- próżnia w rurze próżniowej
- ciśnienie w rurach procesowych 2,8 MPa
- 2. Praca nominalna:
 - temperatury rur procesowych i ekranu termicznego zgodne z warunkami pracy
 - temperatura rury próżniowej 260 °K (minimalna temperaturze otoczenia)
 - próżnia w rurze próżniowej

- ciśnienie w rurach procesowych 2 MPa
- poziome przemieszczenia przyłącza Valve Box (VB rys. 3) – 20 mm
- 3. Wyciek helu:
 - warunki brzegowe jak dla pracy nominalnej
 - dwa sąsiednie segmenty rurociągu ulegają ochłodzeniu o 100 °K wskutek wycieku helu

Przykładowe modele dyskretne oraz wyniki obliczeń linii kriogenicznej, przedstawiono na rysunkach 12–15.



Rys. 13. Model dyskretny kolana: 1 – mocna podpora stała rur procesowych, 2 – podpora stała rury próżniowej, 3 – rura próżniowa, 4 – kompensatory osiowe, 5 – ekran termiczny, 6 – rury procesowe



Rys. 14. Naprężenia zredukowane wg. hipotezy Hubera – Misesa: a) rura próżniowa; praca nominalna – 65 [MPa] okolice 2-go kolana, b) kolano 90; obciążenia próbne – [71] MPa rura procesowa 4,5 K powrót, c) kolano 150; obciążenia próbne – 112 [MPa] rura procesowa 4,5 K powrót, d) – kolano 90; wyciek helu – 73 [MPa] rura procesowej 4,5 K powrót



Termiczne warunki brzegowe dla mocnej podpory rur procesowych



Rozkład temperatury w stałej podporze mocnej



Strumień ciepła w mocnej stałej podporze



Rys. 15. Wybrane wyniki obliczeń MES mocnej podpory stałej rur procesowych dla przypadku obciążenia odpowiadającego pracy nominalnej linii kriogenicznej

Podsumowanie

Zaprezentowano wybrane zagadnienia projektowania i obliczeń wytrzymałościowych linii kriogenicznej przeznaczonej do pracy w ultra niskich temperaturach. W procesie projektowania wykorzystano zaawansowane metody CAD/CAE. Opracowano model geometryczny 3D linii kriogenicznej i przeprowadzono obliczenia numeryczne MES dla przypadków obciążeń odpowiadających rozruchowi i pracy linii w warunkach nominalnych jak również podczas prób oraz możliwych awarii systemu chłodzenia. Uzyskane wyniki wykorzystano do weryfikacji poprawności przyjętych założeń jak również do ustalenia wartości parametrów złożonego systemu podparcia i kompensacji odkształceń linii kriogenicznej. Projekt linii kriogenicznej posiada wiele rozwiązań innowacyjnych. Opracowano pełną dokumentację konstrukcyjną, która została zatwierdzona przez certyfikowaną jednostkę TÜV NORD w zakresie technicznym i wykonawczym i stanowiła podstawę wykonania, montażu i próbnych badań linii kriogenicznej. Zaprojektowana i wykonana linia XATL1, służy aktualnie do testowania wnęk rezonansowych do lasera na swobodnych elektronach (XFEL) w ośrodku naukowo badawczym DESY w Hamburgu.

Literatura

- Fydrych J., Chorowski M., Polinski J., SkrzypaczJ., Design Methodology of Long Complex Helium Cryogenic Transfer Lines. Transactions of the Cryogenic Engineering Conference-CEC: Advances in Cryogenic Engineering. AIP Conference Proceedings, Volume 1218, pp. 1103-1110 (2010)
- [2] Fydrych J., Skrzypacz J., Chorowski M., Thermo-mechanical static analysis of the process lines and external vacuum envelope of the XFEL/AMTF cryogenic transfer line XATL1, Raporty Inst. Inz. Lot. Proces. Masz. Energ. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 14 (2009)
- Skrzypacz J., Fydrych J., Chorowski M., Conceptual design of cryogenic transfer line XATL1 for XFEL/AMTF (in Polish), Raporty Inst. Inż. Lot. Proces. Masz. Energ. PWroc., Ser. SPR nr 25 (2009)
- [4] Iluk A., Rusiński E., Strength analysis of the kinematic pairs of a mobile collapsible bridge, Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2011, vol. 11, nr 4, s. 875-884
- [5] Rusiński E., Finite Element Method System COSMOS/M, WKŁ, Warsaw 1994
- [6] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Advanced Finite Element Method for Load-carrying Structures of Machines (in Polish), Oficyna Wydawnicza PWr., Wroclaw 2000
- [7] Rusiński E., Design Principles for Supporting Structures of Self-Propelled Vehicles (in Polish), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002

